

日本化粧品技術者会誌 Vol.48, No.2 (2014年6月号) 目次

特集総説 紫外線防御化粧品を支える技術と製剤 ④

高い紫外線防御効果とみずみずしい感触を両立させたサンスクリーン製剤の開発	小田島秀樹	83
---	-------	----

報 文

ホスホリルコリン類似基を有するジェミニ型化合物「2-(Dimethyldocosylammonio)ethyl octadecyl ethyl phosphate」の基本特性と化粧品原料としての有用性	大川 洋, 英 謙二, 鈴木正浩, 福井洋樹	90
地肌マッサージの頭皮への作用.....	曾我 元, 森田康治, 新井賢二	97

ノ ー ト

自己会合性を有するジェミニ型化合物「2-(Dimethyldocosylammonio)ethyl octadecyl ethyl phosphate」の経皮吸収促進効果	大川 洋, 英 謙二, 鈴木正浩, 福井洋樹	104
上下運動型振動パフのメーキャップ効果	崔 汀善, 崔 榮鎭, 朴ウラム, 卞 庚姫, 鄭 春福	109

レポ ー ト

第43回 SCCJ セミナー		114
----------------------	--	-----

技術情報

日本化粧品工業連合会技術情報 (No. 383, 384)		117
Journal of Cosmetic Science (Vol. 64, No. 5)		134
International Journal of Cosmetic Science (Vol. 35, No. 5)		137

本会の記事

日本化粧品技術者会のご案内.....		142
会の動静.....		143

学会行事予告

第74回 SCCJ 研究討論会／第44回 SCCJ セミナー／IFSCC フランス大会／ 第75回 SCCJ 研究討論会／IFSCC フランス大会・国内報告会／第45回 SCCJ セミナー／ 第12回 ASCS 大会／第65回コロイドおよび界面化学討論会／第16回日本感性工学会大会／ 「コスメティクスと肌・顔研究会」研究発表会演題募集		149
---	--	-----

日本化粧品技術者会規約.....		152
日本化粧品技術者会細則.....		156
日本化粧品技術者会東京支部細則.....		158
日本化粧品技術者会大阪支部細則.....		160
日本化粧品技術者会誌投稿規定.....		162
日本化粧品技術者会誌投稿の手引き.....		163
SI 単位表		165
協賛広告一覧.....		165
SCCJ ジャーナル協賛広告応募要項		166
雑感.....	吉岡正人	167
編集後記.....	浅越 亨	167

表紙

デザイン：小林 豊（資生堂宣伝制作部）

写 真：中村成一（中村写真事務所）

Journal of SCCJ Vol.48, No.2 Contents

Special Review

- Development of Sunscreens with High UV Protection Effect and Fresh Texture
..... Hideki Kodashima 83

Originals

- Fundamental Properties and Efficacies for a Cosmetic Ingredient of a Gemini Compound Bearing
the Phosphorylcholine-like Moiety [2-(Dimethyldocosylammonio) ethyl octadecyl ethyl phosphate]
..... Hiroshi Okawa, Kenji Hanabusa, Masahiro Suzuki, Hiroki Fukui 90
- Effects for Scalp Blood Flow and Properties from Scalp Massage
..... Hajime Soga, Kouji Morita, Kenji Arai 97

Notes

- Transdermal Penetration-enhancing Effect of a Gemini Compound with Self-assembly
[2-(Dimethyldocosylammonio) ethyl octadecyl ethyl phosphate]
..... Hiroshi Okawa, Kenji Hanabusa, Masahiro Suzuki, Hiroki Fukui 104
- Makeup Effects of a Tapping Puff on the Skin
..... Choi JungSun, Choi YoungJin, Park WooRam, Byoun KyoungHee, Jeong ChoonBok 109

複写をご希望の方へ

日本化粧品技術者会は、本誌掲載著作物の複写に関する権利を一般社団法人学術著作権協会に委託しております。本誌に掲載された著作物の複写をご希望の方は、(社)学術著作権協会より許諾を受けて下さい。但し、企業等法人による社内利用目的の複写については、当該企業等法人が社団法人日本複写権センター((社)学術著作権協会が社内利用目的複写に関する権利を再委託している団体)と包括複写許諾契約を締結している場合にあっては、その必要はございません(社外頒布目的の複写については、許諾が必要です)。

権利委託先 一般社団法人学術著作権協会 〒107-0052 東京都港区赤坂9-6-41 乃木坂ビル 3F
FAX: 03-3475-5619 E-mail: info@jaacc.jp

複写以外の許諾(著作物の引用、転載、翻訳等)に関しては、(社)学術著作権協会に委託致しておりません。直接、日本化粧品技術者会 info@sccj-ifscc.com へお問い合わせください。